

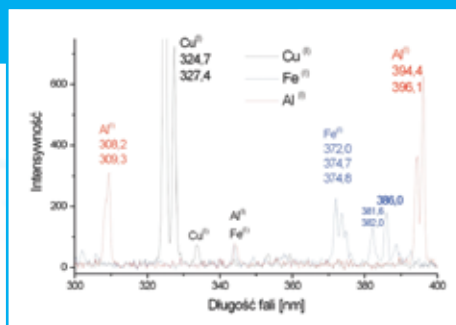
SYSTEM STEROWANIA PROCESEM WIELOŹRÓDŁOWEGO ROZPYLANIA MAGNETRONOWEGO

[Systemy sterowania]

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA

System sterowania procesem wieloźródłowego rozpylania magnetronowego pracuje w oparciu o emisyjną analizę plazmy procesowej. W jego skład wchodzi: kompaktowy spektrometr optyczny HR4000 ze światłowodowym układem wejściowym, programowalny moduł cyfrowy NI PXI 1024Q, zespół przetworników umożliwiających współpracę systemu z zespołem stałoprądowych zasilaczy źródeł magnetronowych oraz interfejs użytkownika (panel operatorski na monitorze LCD – oprogramowanie, klawiatura i mysz). Jednostka centralna pracuje pod kontrolą oprogramowania zbudowanego na platformie LabView.

System zawiera 3 kanały optyczne, co pozwala na niezależne sterowanie mocą trzech źródeł magnetronowych.



PARAMETRY TECHNICZNE

Liczba wejściowych kanałów optycznych:	3
Liczba wyjściowych kanałów sterujących mocą zasilaczy:	3
Dokładność nastawy szerokości 3 przedziałów spektralnych:	1 nm
Zakres pomiarowy spektrometru:	195÷1123 nm
Dokładność regulacji mocy zasilaczy:	±1 W
Zakres regulacji mocy zasilaczy:	0÷3000 W
Rodzaj komunikacyjnego portu wyjściowego:	USB/RS485
Oprogramowanie pomiarowo-sterujące oraz interfejsu:	LabView 8.6



INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY W RADOMIU
ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom, tel. centr. +48 364 42 41, fax +48 364 47 60, instytut@itee.radom.pl, www.itee.radom.pl



POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, INSTYTUT MECHATRONIKI, NANOTECHNOLOGII I TECHNIKI PRÓŻNIOWEJ
ul. Śniadeckich 2, 75-620 Koszalin, tel. centr. +94 34 78 399, imnitp.dziekana@tu.koszalin.pl, www.imnitp.tu.koszalin.pl